

請求の範囲

- [請求項1] 多結晶シリコンに対して、フッ硝酸を接触させる第一洗浄工程と、
前記第一洗浄工程を経た多結晶シリコンに対して、フッ酸を含む非酸化性薬液を接触させる第二洗浄工程と、を含むことを特徴とする多結晶シリコンの洗浄方法。
- [請求項2] 前記第二洗浄工程を経た多結晶シリコンの表面に酸化膜を形成させる第三洗浄工程を含むことを特徴とする請求項1に記載の多結晶シリコンの洗浄方法。
- [請求項3] 前記第三洗浄工程において、多結晶シリコンに対して、フッ硝酸を接触させることを特徴とする請求項2に記載の多結晶シリコンの洗浄方法。
- [請求項4] 前記非酸化性薬液が、フッ化水素を1～10質量%含むことを特徴とする請求項1～3のいずれか1項に記載の多結晶シリコンの洗浄方法。
- [請求項5] 請求項1～4のいずれか1項に記載の洗浄方法を一工程として含むことを特徴とする多結晶シリコンの製造方法。
- [請求項6] 多結晶シリコンに対して、フッ硝酸を接触させる第一洗浄部と、
前記第一洗浄部による処理を経た多結晶シリコンに対して、フッ酸を含む非酸化性薬液を接触させる第二洗浄部と、を備えることを特徴とする多結晶シリコンの洗浄装置。